静電浮遊法と X 線非弾性散乱法を用いた液体シリコンの原子ダイナミク スの観察

JAXA 正木匡彦,石川毅彦 東京大学 岡田純平 千葉工大 古池紀之、

The Observation of atomic dynamics in liquid silicon by using inelastic x-ray scattering method coupled with electrostatic levitation method

Tadahiko Masaki¹, Takehiko Ishikawa¹, Jyunpei T. Okada², and Noriyuki Koike³ 1: Japan Aerospace Exploration Agency

E-Mail: <u>masaki.tadahiko@jaxa.jp</u>

2: Tokyo Univ.

3: Chiba Inst. Tech.

Abstract: The atomic dynamics in high temperature melts are essential information for the understanding of the relation between liquid structure and thermo-physical properties in liquid state. The small electrostatic levitation furnace, ESL, was developed for the inelastic x-ray scattering facility in SPring-8. The observation of dynamic liquid structure factor, S(Q,w) of normal and undercooled liquid silicon was performed. The phonon peak of S(Q,w) in the liquid silicon was clearly observed and its dispersion relation can be obtained.

Key words; Electrostatic levitation furnace, liquid structure

1. 緒言

金属や半導体の液体の原子の運動を理解するこ とは、凝集体物理におけるランダム系の原子ダイナ ミクスの問題だけでなく、凝固過程や結晶成長プロ セスにおける固液界面近傍の原子ダイナミクスな どの重要な情報を与える。近年,高輝度放射光や高 密度中性子源など、非弾性散乱実験装置の高度化が 著しく進んでおり、種々の物質の原子ダイナミクス を短時間で、かつ、高精度に観測できるようになり つつある。

一方、無容器実験法を用いた高温液体や過冷却液 体状態の研究が盛んに進められており,静電場法, 電磁誘導法やガスジェット法などの手法を用いた 過冷却液体の物性・構造研究や凝固過程の研究が 進められている[1-5]。その中でも,静電場を用いた 液滴浮遊法は,金属・非金属を問わずに浮遊できる 点だけでなく,サンプルサイズ(直径1~2mm) や雰囲気(高真空もしくは高圧)などの実験条件が 高温液体の物性計測や構造解析に適した方法であ る[6]。これらの浮遊法は、主に二軸回折計やイメー ジングプレートなどを用いた静的構造の解析に用 いられてきたが、非弾性散乱法による動的構造構造 解析に対しては実験の難しさからこれまでほとん ど適用されてこなかった。

JAXAではこれまで、宇宙空間の微小重力環境 における浮遊試料の位置制御法として静電浮遊法 を開発してきた[6]。良く知られているように、微小 重力環境において浮遊させた液滴を用いることに より、極めて高精度の液体物性を測定することが可 能である。本研究は、その宇宙実験技術を地上の研 究へスピンオフし、過冷却金属液体の原子ダイナミ クスの観察を世界に先駆けて可能にするものであ る。なお、この研究は宇宙環境利用と独立したもの ではなく、宇宙実験による高精度融液物性データを 微視的な立場から理解し補完することを目的とし ている。

我々は、過冷却液体状態を安定して保持できる静 電浮遊法とSPring-8の高輝度放射光を用いた非弾性 X線散乱法を組み合わせることにより液体の動的 構造の解析装置を製作した。装置の性能を確認する ため、過冷却液体状態を比較的安定に保持すること が可能であり、かつ、X線の吸収係数が比較的小さ な液体シリコンを対象として、非弾性X線散乱法に よる動的構造の観察を行った。以下に装置および実 験の概要を紹介する。

2. 高輝度放射光を用いた高分解能非弾性 X 線散乱 実験

液体内の原子のダイナミクスを取り扱う際に、時間に依存した二体相関関数、G(r, τ)、を考えることが重要である。G(r, τ)は Van Hove 時空相関関数と呼ばれ、以下の式により定義される[7]。

$$G(r,\tau) = \frac{1}{N} \left\langle \sum_{i,j=1}^{N} \delta \left[\mathbf{r} + \mathbf{R}_{i}(0) - \mathbf{R}_{j}(\tau) \right] \right\rangle$$
(1)

 $G(r, \tau)$ はある時刻において見出した原子が τ

時間後にそこから距離 r 離れた位置に見出される確 率を示している。非弾性散乱実験において実測され る動的構造因子S(Q, ω)は、G(r, τ)を時 間および空間においてフーリエ変換することにより 以下の式により得られる。

$S(Q,\omega) = \iint d\mathbf{r} d\tau \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega\tau)]G(r,\tau) \quad (2)$

一般に非弾性散乱実験では、試料に対して入射し た波の運動量およびエネルギーと試料からある特定 の方向に散乱された波の運動量とエネルギーの差か ら、個々の原子または原子団の集団運動を表す動的 構造因子S(Q,ω)を決定する。液体内の原子の運 動にかかわるエネルギー遷移は、一般に数meV程度 であることが知られている。一方、放射光施設にお いてよく用いられるX線のエネルギーは数+keVで あり、X線を用いてS(Q, ω)を決定するためには 10-6オーダーの極めて高い分解能の測定をする必要 がある。SPring-8のBL35XUに設置された高分解能非 弾性X線散乱計測装置は、バックスキャッタリング モノクロメータを含む複数のモノクロメータと湾曲 シリコン結晶のアナライザおよび10mのアーム長 さを有する大型ゴニオメータを組み合わせた大規模 な装置である。バックスキャッタリングモノクロメ ータ結晶とアナライザ結晶の温度を変化させて格子 定数を変え、回折するX線のエネルギーをわずかに 変化させることにより、高輝度・高エネルギーの放 射光を使用しながら、エネルギーの分解能関数の半 値幅を 1meV以下にすることが可能であり、液体内 のフォノンのような極めて微弱かつ低エネルギーの 運動モードの検出をすることができる。

3. 高分解能非弾性 X 線散乱実験用の静電浮遊装置の開発

静電場を用いる場合,試料を帯電させることにより 金属・非金属を問わず浮遊させることが可能であ る。本研究では上下に配置した電極の上側に-10 ~-30kVの電圧を印加し,また正電荷を帯電さ せた試料を電極間に挿入し,重力と拮抗した上向き の力を発生させた。このような電極と試料の配置で は、パッシブな安定点が存在しないことから,試料 を電極間電圧の制御を高速に行う必要がある。本装 置では、ポジションディテクタからの信号を元に高 速直流アンプをコンピュータ制御し,約1KHzの 制御サイクルにより安定した浮遊状態を実現した。 電極間に高電圧をかけることから,電極と試料は 10⁻⁴ P a 程度の真空を維持できる高真空チャンバー 内に配置した。高真空雰囲気は,溶融させた試料の 酸化を防ぐとともに,試料の帯電状態の維持に寄与



Fig.1 Schematic figure of Electorstatic Levitator for the inelastic x-ray scattering facility in BL35XU

している。

BL35XUの高分解能X線散乱装置は、エネルギー 分解能を可能な限りあげるため、入射光を絞るスリ ットや散乱光の検出器が、試料部に接近して配置さ れている。たとえば、試料中心から検出器までの距 離は60mmである。我々は、従来の静電浮遊炉を 大幅に簡略化し、真空チャンバーの直径が100 mmの小型静電浮遊炉を新たに製作した。Fig.1 は真 空チャンバーの模式図であるが、直径100mmの 円筒に入射と散乱 X線用の窓を含め7枚の窓を、O リングを用いて固定し、また、試料の加熱に使用す る一対のファイバーカップル型半導体レーザーの対 物レンズを斜め上方に配置することにより、真空チ ャンバーの小型化を図った。Fig.2は、BL35XUに設 置した静電浮遊装置の写真であるが、位置検出用の He-Ne レーザーをはじめ、種々の光学機器が真空チ ャンバー周辺に密集して配置されている様子がわか る。

BL35XUを用いた非弾性X線散乱の計測では、あ るひとつのQの値に対して、-50meVから+50meVの エネルギー遷移を測定するためには、約1時間程度 の積算時間を要する。すなわち、過冷却液体の動的 構造因子を測定するためには浮遊させた液滴を最低 でも1時間程度、安定に保持する必要がある。その ため、本装置は従来の二次元の位置検出器に加え、 CCD カメラからの画像データから直接試料位置を 検出し、試料の絶対位置を自動で補正する回路を加 えた。本回路はきわめて有効に機能し、試料の重心 位置変動が 0.1mm 以下のきわめて安定した浮遊液 滴の保持が可能であった。



Fig.2 Photo of electrostatic levitation on the sample stage at BL35XU

4. 高分解能非弾性X線散乱実験による液体シリコンの動的液体構造の測定

今回の実験では、融点および融点より170K過 冷却した液体シリコンの動的構造因子の測定を行っ た。測定試料には直径2mmの球状シリコンを用い た。測定したQの範囲は1.32nm-1から41.4nm-1で あり、εの範囲は-10meVから50meVである。

測定された非弾性散乱強度の一例として、融点に おけるQ=1.32nm-1のデータを Fig.3 示す。図には 吸収補正したバックグラウンド(チャンバー単体) の散乱強度をあわせて示した。浮遊液滴を用いるこ とにより、バックグラウンドの補正が容易になり、 液体内のフォノンに起因するブリルアン散乱を明瞭 に観察することができた。このブリルアン散乱は、 流体極限におけるS(Q,ω)において以下のよう にあらわされる。

$$S(Q,\omega) = \frac{2k_B T D_L}{m} Q^4 \left[(\omega^2 - c_T^2 k^2)^2 + (\omega k^2 D_L)^2 \right]^{-1}$$
(3)

ここで、 C_T は音速であり D_L はShear viscosity: η とBulk viscosity: $\boldsymbol{\zeta}$ および密度: ρ を用いて以下のようにあらわされる。

$$D_L = \left(\frac{4}{3}\eta + \varsigma\right) / (m\rho) \tag{4}$$

すなわち、ブリルアンピークの位置から音速に相当 する量を求めることができ、その半地幅から粘性率 に関わる量を求めることができる。現在、これ以外 の実験データについて、詳細な解析を進めている。



Fig.3 S(Q,w) of liquid Si at m.p.

6. 結言

静電浮遊法および高分解能非弾性X線散乱法を 用いて,高温金属液体および過冷却液体状態の動的 構造因子の測定を試みた。この手法を用いることで, 超高温融体や極めて深い過冷却液体状態の構造の 研究や輸送物性の理論計算を進めることが可能で ある。本研究が,将来の微小重力環境を利用した過 冷却液体の熱物性研究の相補的な役割を担い、熱物 性研究の進歩に寄与することを期待する。

参考文献

- T.Ishikawa, P.-F Paradis; T.Itami and S. Yoda, Meas. Sci. Technol. 16(2005), 443-451.
- [2] K. Higuchi et al. Meas. Sci. Technol. 16(2005), 381-385.
- [3] S. Krishnan and D. Price, J. Phys: Cond. Matter, 12(2000), R145-R176.
- [4] K. Kelton, G.W. Lee, A. K. Gangopadhyay, R. W. Hyers, T. J. Rathz, J. R. Rogers, M. B. Robinson and D. S. Robinson, Phys. Rev. Lett., 90(2003), 195504.
- [5] D. Holland-Moritz, D. M. Herlach and K. Urban, Phys. Rev. Lett., 71(1993), 1196.
- [6] T. Ishikawa, P.-F. Paradis, and S. Yoda, J. Japan

Microgravity Appl., 18(2001), 106.

[7] N. H. March and M. P. Tosi, "Atomic Dynamics in Liquids", Dover Pub, 1991.